

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 7 月 30 日(30.07.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/111631 A1

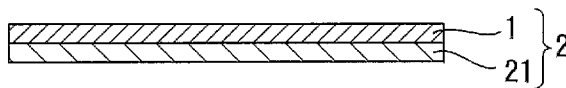
- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/051566
- (22) 国際出願日: 2015 年 1 月 21 日(21.01.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-009242 2014 年 1 月 22 日(22.01.2014) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山本 大輔(YAMAMOTO, Daisuke); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 米山 裕之(YONEYAMA, Hiroyuki); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA, Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PROTECTIVE MEMBRANE FORMING FILM, PROTECTIVE MEMBRANE FORMING SHEET, COMPOUND SHEET FOR FORMING PROTECTIVE MEMBRANE, AND PRODUCT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 保護膜形成フィルム、保護膜形成用シート、保護膜形成用複合シートおよび加工物の製造方法



(57) Abstract: Provided is protective membrane forming sheet (2) comprising: a protective membrane forming film (1) characterized by having a light transmittance at a wavelength of 1064nm of 55% or more and a light transmittance at a wavelength of 550nm of 20% or less; and a peeling sheet (21) which is layered upon one or both faces of the protective membrane forming film (1). According to this protective membrane forming sheet (2), it is possible to form a protective film which allows a workpiece such as a semiconductor wafer to have a reforming layer disposed in advance therein by a laser so that the workpiece can be split through the application of force thereon, while preventing grinding marks on the workpiece or a product formed therefrom from being visible to the naked eye.

(57) 要約: 波長 1064nm の光線透過率が 55% 以上であり、波長 550nm の光線透過率が 20% 以下であることを特徴とする保護膜形成フィルム (1) と、その保護膜形成フィルム (1) の一方の面または両面に積層された剥離シート (21) とを備えた保護膜形成用シート (2)。かかる保護膜形成用シート (2) によれば、半導体ウエハなどのワークを、レーザーにより予備的に改質層を設け、力を与えることで分割することが可能であり、かつワークまたは加工物に存在する研削痕が目視によって見えない保護膜を形成することができる。



WO 2015/111631 A1